OSW 2025 라마락 광반도체 워크숍 2025

The 1st Optical Science & Opto-Semiconductor Workshop

Recent technologies of PIC (Photonics Integrated Circuit)

Optical technologies for Semiconductor Processing

2025.**6.16**(월)~**18**(수) 수원컨벤션센터























Poster Presentation Session

niversity)		
고효율 PIC-광섬유 결합을 위한 마이크로렌즈 인터페이스 A High-Efficiency Microlens Interface for PIC-to-Fiber Coupling *WHANG Gyu-Chan, KIM Moo-Hyuk, KIM Myung-Ki (Korea University)		
Enhanced Field Localization in (Short-Wave Infrared) SWIR Surface Plasmon Resonance Using 2D Ti ₃ C ₂ T _x MXene Films *KIM Han-Na, KIM Myung-Ki, SONG Da-In, JIN Young-Ho, YU A-Ran (Korea University), KIM Hye-Rim, KOO Chong-Min (Sungkyunkwan University)		

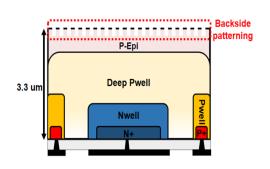
CMOS 공정 기반 고성능 단일광자 아발란치 다이오드

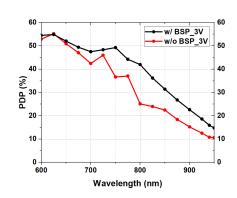
엄도윤*, 최현승, 최우영, 이명재**

연세대학교 전기전자공학과

*dja1995@yonsei.ac.kr, **mj.lee@yonsei.ac.kr

단일광자 아발란치 다이오드(Single-Photon Avalanche Diode, SPAD)는 여러 바이오 및 라이다 응용 분야에서 핵심 센서 기술로 활용될 것으로 전망되며, 많은 응용에 있어 높은 광자 검출 효율 (Photon Detection Probability, PDP)이 가장 중요한 조건이다[1]. 이를 위해 비격리 구조를 적용한 후면조사형 SPAD가 연구되고 있지만, 대부분 자체 개발된 내부 공정을 사용해 파운드리 CMOS와의 호환성에 한계가 있었다[2]. 본 연구에서는 파운드리 CMOS 이미지 센서(CIS) 공정 기반으로 후면조사형 비격리 SPAD를 설계, 제작(그림1)하고, 후면 패터닝(Backside Patterning, BSP) 기술을 적용하여 장파장 영역에서의 PDP를 크게 향상시켰다. 실험 결과, 제안된 SPAD는약 30V의 항복 전압과 3V 초과 전압 조건에서 단위 면적당 약 1 cps 이하의 매우 낮은 노이즈 (Dark Count Rate, DCR) 특성을 보였으며, 600~950nm 파장대에서 최대 약 55%의 PDP를 달성했다(그림2). 특히 BSP 기술을 통해 940nm 파장에서 PDP가 16%까지 도달하며, 기존 대비 약 47% 향상된 성능을 나타냈다. 본 연구는 고성능 후면조사형 SPAD의 CMOS 공정 기반 상용화가능성을 보여주며, 바이오, 라이다 등 차세대 센서 분야에서 크게 활용될 것으로 기대된다.





[그림1] 후면조사형 비격리 단일광자 아발란치 다이오드의 구조

[그림2] 후면조사형 비격리 단일광자 아발란치 다이오드의 후면 패터닝 유무에 따른 광자 검출 효율 (PDP) 비교

Acknowledgments

This work was supported by the Yonsei University Research Fund of 2024 (2024-22-0504) and the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Ministry of Science and ICT (MSIT, Korea) (RS-2025-02218723).

References

- [1] M.-J. Lee *et al.*, "High-performance back-illuminated three-dimensional stacked single-photon avalanche diode implemented in 45-nm CMOS technology," *IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron.*, vol. 24, no. 6, Nov.-Dec. 2018.
- [2] S. Shimada *et al.*, "A SPAD depth sensor robust against ambient light: the importance of pixel scaling and demonstration of a 2.5µm pixel with 21.8% PDE at 940nm," in *International Electron Devices Meeting(IEDM)*, San Francisco, CA, USA, Dec. 2022, pp. 37.3.1-37.3.4.

CMOS 공정 기반 고성능 단일광자 아발란치 다이오드

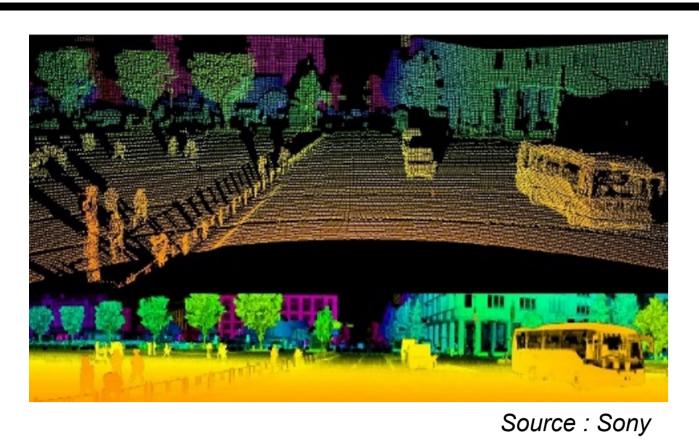
OSV/ 2025 엄도윤*, 최현승, 최우영, 이명재**

연세대학교 전기전자공학과

*dja1995@yonsei.ac.kr, **mj.lee@yonsei.ac.kr



SPAD Applications





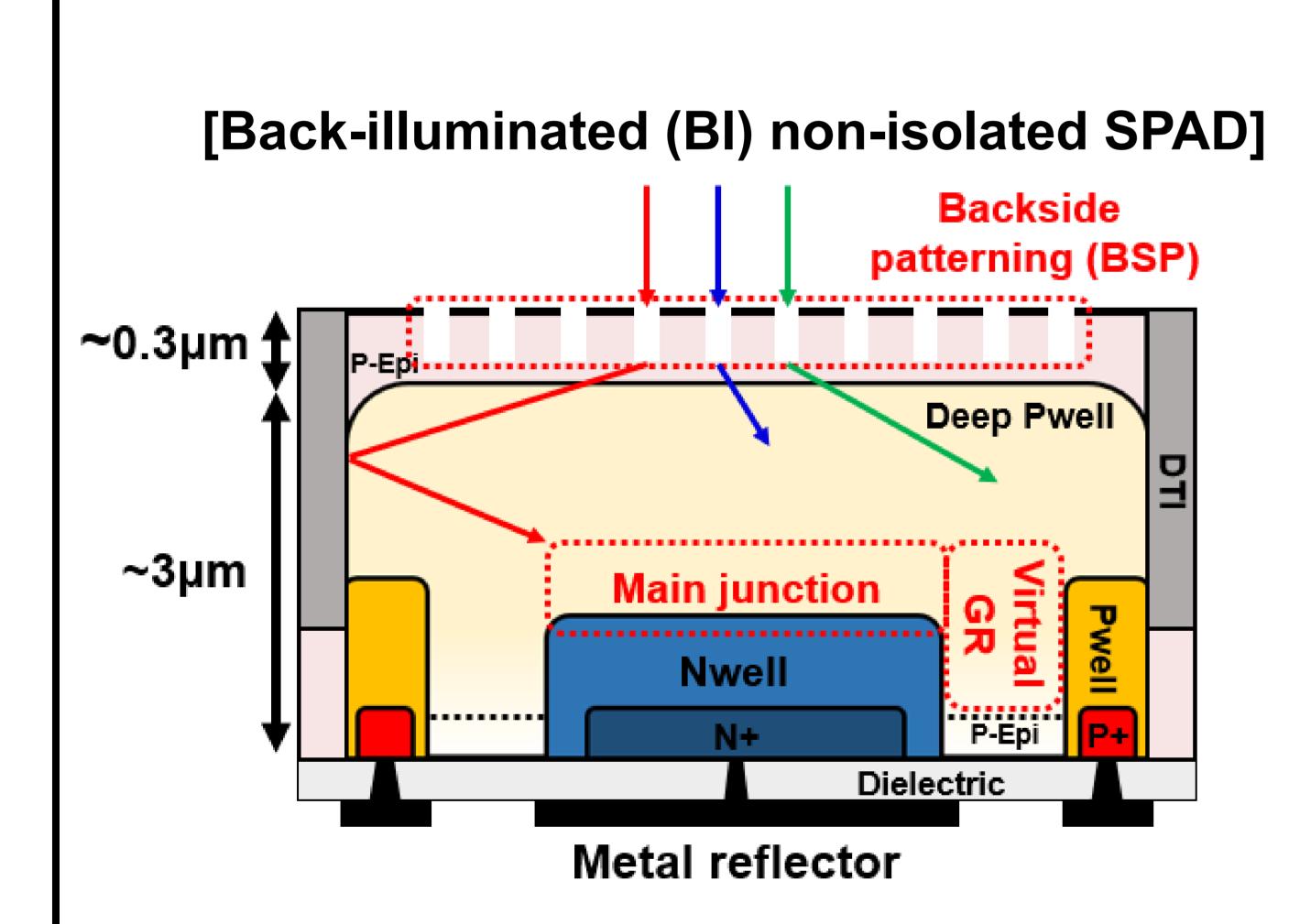
Source: GE HealthCare

[Autonomous vehicles]

[ToF PET]

• Single-photon avalanche diodes (SPADs) are widely used in several applications such as autonomous vehicles and timeof-flight positron emission tomography (ToF PET).

Device Structure and Simulation

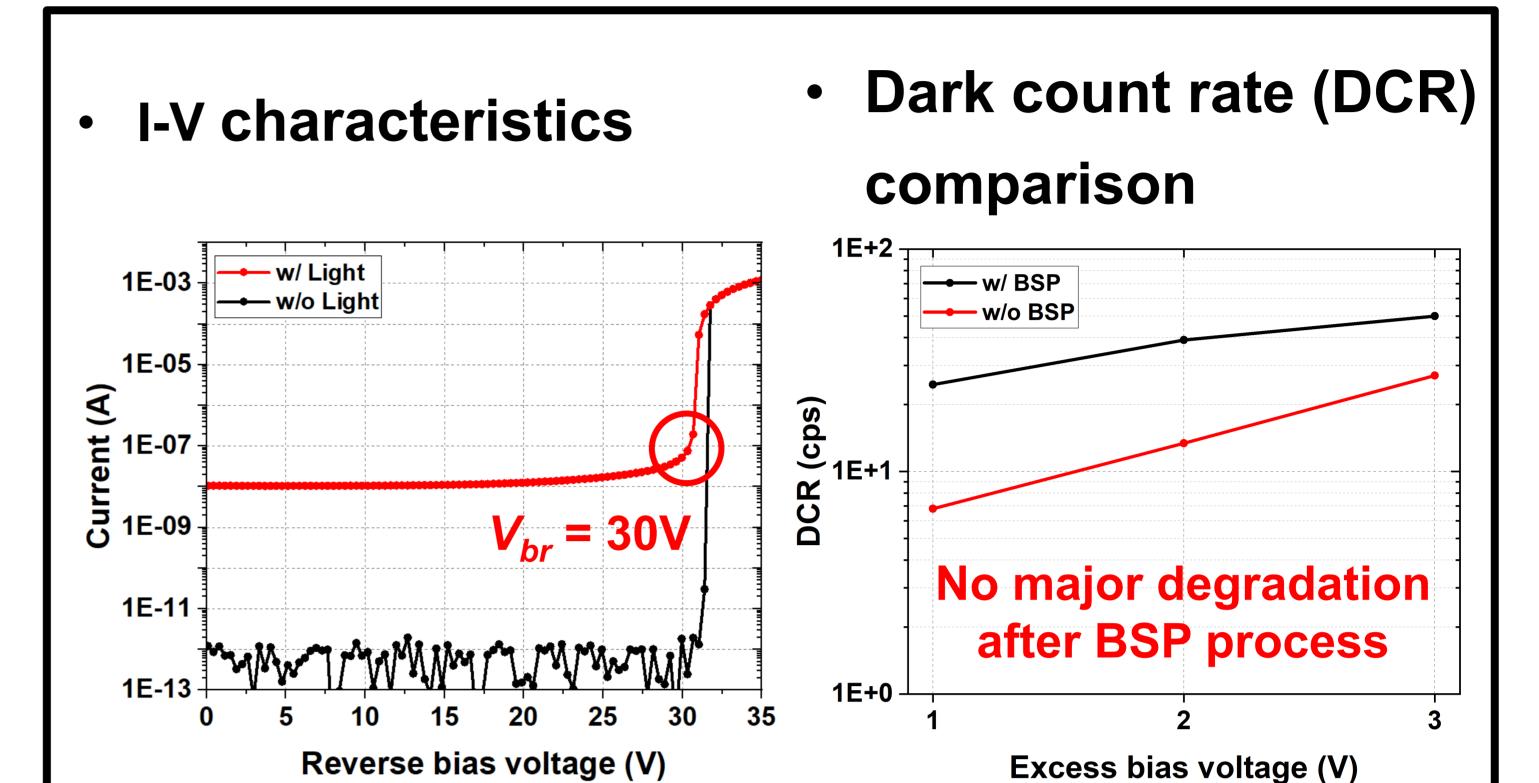


- Device features
 - Main junction : Nwell / Deep Pwell
 - Guard-ring : Virtual GR
 - Backside partterning (BSP)
 - Deep trench isolation (DTI)
 - Metal reflector

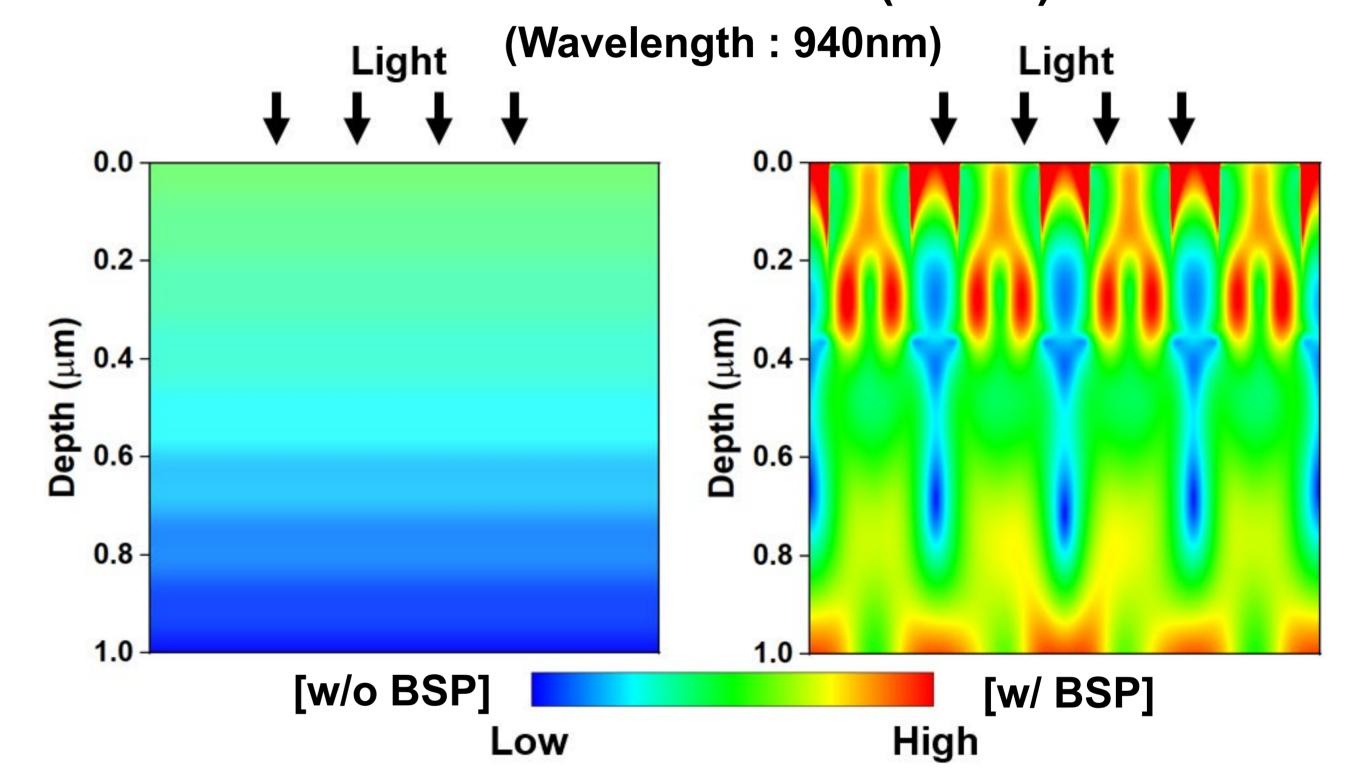
Conclusion

- The proposed BI non-isolated SPAD with backside patterning achieves a ~50% higher PDP at 940nm than the default SPAD while it shows a comparable DCR.
- The PDP will be improved by increasing the thickness of the P-Epi.
- It is expected to play an important role in biomedical and LiDAR applications.

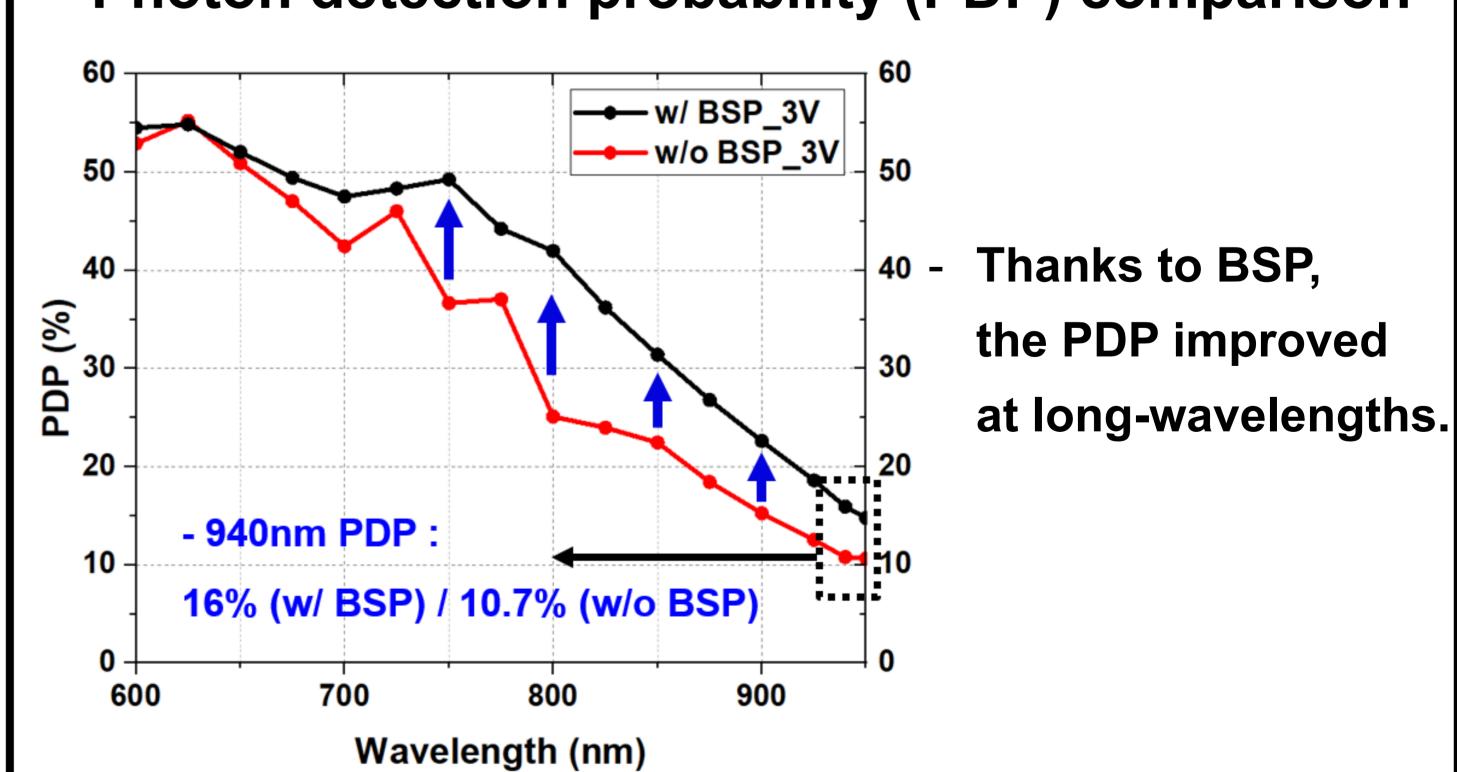
Results



Finite-difference time-domain (FDTD) simulation



- Backside patterning (BSP) effectively enhanced the incident light through diffraction.
- Photon detection probability (PDP) comparison



Performance summary

	w/o BSP	w/ BSP
Active area	10µm	
Breakdown voltage	30V	
Excess voltage	3V	
DCR (cps / µm²)	0.34	0.64
940nm PDP	10.7%	16%